

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年6月11日(11.06.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/115968 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/24 (2012.01) *C08G 18/76* (2006.01)
B24B 37/22 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/034512
- (22) 国際出願日: 2019年9月3日(03.09.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-226291 2018年12月3日(03.12.2018) JP
- (71) 出願人: 株式会社クラレ (**KURARAY CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒7100801 岡山県倉敷市酒津1621 Okayama (JP).
- (72) 発明者: 加藤 充(**KATO Mitsuru**); 〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島7471番地 株式会社クラレ内 Okayama (JP). 岡本 知大(**OKAMOTO Chihiro**); 〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島7471番地 株式会社クラレ内 Okayama (JP). 加藤 晋哉(**KATO Shinya**); 〒1008115 東京都千代田区大手町1-1-3 株式会社クラレ内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 江川 勝, 外 (**EGAWA Masaru et al.**); 〒5940071 大阪府和泉市府中町7丁目4番18号 サンビル2階 江川特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: POLYURETHANE FOR POLISHING LAYERS, POLISHING LAYER AND POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨層用ポリウレタン、研磨層及び研磨パッド

(57) Abstract: A polyurethane for polishing layers, which has a terminal group represented by formula (I) $R-(OX)_n-$; a polishing layer which uses this polyurethane for polishing layers; and a polishing pad. (In formula (I), R represents a monovalent hydrocarbon group having 1-30 carbon atoms, which may be substituted by a heteroatom or may be intervened by a heteroatom; X represents an alkylene group having 2-4 carbon atoms, 90-100% of which is an ethylene group; and n represents a number of 8-120.)

(57) 要約: 下記式 (I) : $R-(OX)_n-\cdots(I)$ [式 (I) 中、R はヘテロ原子で置換されていてもよく、ヘテロ原子が介在していてもよい炭素数 1~30 の一価の炭化水素基を示し、X は 90~100% がエチレン基である炭素数 2~4 のアルキレン基を示し、n は 8~120 の数を示す] で表される末端基を有する研磨層用ポリウレタン、それを用いた研磨層及び研磨パッド。



WO 2020/115968 A1